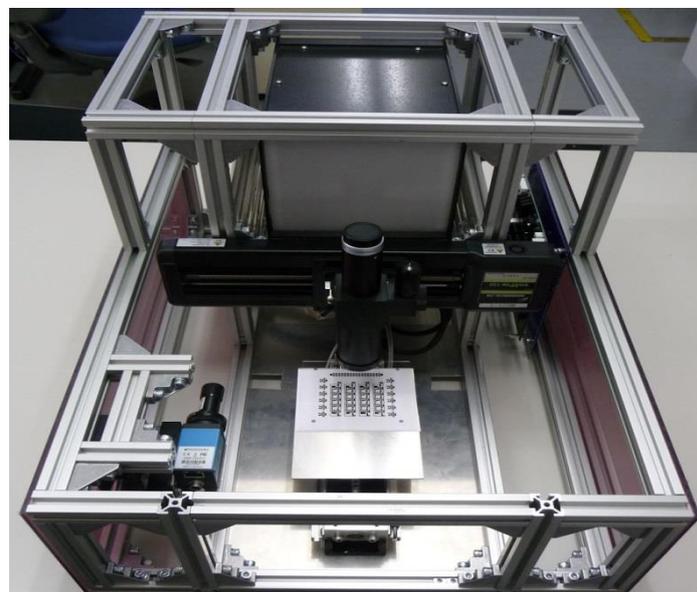


波長285nmで親撥水処理パターン描画装置

- 1) 有機物の分子結合エネルギーを切断できるフォトンエネルギー。ポリイミド膜等の表面に親水領域を描画します。
- 2) インクジェット・インクをパターン上に導き、バルジ等を改善します

- ・285nm高出力UVLED
LED使用の安価光学系
- ・パターン幅200 μ m
- ・描画域 100×100mm
- ・DXFファイル使用可



※. 予価: おおよそ 250万円

波長285nmの表面改質露光・光源

- 1) 有機物の分子結合エネルギーを切断できるフォトンエネルギー
- 2) 有機物の揮発除去には、活性化酸素が不可欠。
発生はフォトンエネルギー依存。285nmは約420kJ/molの高エネルギーで有機物の除去に非常に有効です。

- ・285nm高出力UVLED
LED使用の安価光学系
- ・照射域 130×130mm
- ・耐紫外線劣化防止工法
- ・



※. 予価: おおよそ 100万円